

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年11月25日(2010.11.25)

【公表番号】特表2010-507261(P2010-507261A)

【公表日】平成22年3月4日(2010.3.4)

【年通号数】公開・登録公報2010-009

【出願番号】特願2009-533464(P2009-533464)

【国際特許分類】

H 05 K 9/00 (2006.01)

C 08 J 7/04 (2006.01)

H 01 B 5/14 (2006.01)

H 01 B 13/00 (2006.01)

【F I】

H 05 K 9/00 V

C 08 J 7/04 C F D D

H 01 B 5/14 B

H 01 B 13/00 5 0 3 D

【手続補正書】

【提出日】平成22年10月4日(2010.10.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリマー基材上で第1物質をパターニングする方法であって、前記方法が、
凹部領域と、隣接する隆起領域と、を含むレリーフパターンの付いた主要表面を有する
、ポリマーフィルム基材を提供する工程と、
前記ポリマーフィルム基材の前記主要表面上に第1物質を堆積させて、コーティングさ
れたポリマーフィルム基材を形成する工程と、
前記コーティングされたポリマーフィルム基材の前記隆起領域の上に機能化材料の層を
選択的に形成して、機能化された隆起領域と機能化されていない凹部領域とを形成する工
程と、

前記ポリマー基材の機能化されていない凹部領域から前記第1物質を選択的にエッチング
して、第1物質のパターニングされたポリマー基材を形成する工程と、を含み、

ポリマーフィルム基材上で第1物質をパターニングする前記方法が、ロールツーロール
加工装置を用いて実施され、かつ、第1物質を堆積する前記工程が、金属を前記ポリマ
ー
基材上に堆積することを含む、方法。